# PCT

### 国際事務局



# 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類 5 C08F 212/14, 220/06, 220/28 C08F 220/36, 220/58 C08L 101/02, C08F 220/60 C08F 222/02, 6/14, 8/44

(11) 国際公開番号

WO 92/20721

(43) 国際公開日

1992年11月26日(26.11.1992)

(21)国際出願番号 (22)国際出願日

(30) 優先権データ

PCT/JP92/00663

A1

1992年5月22日(22.05.92)

(81) 指定国

AT(欧州特許), BE(欧州特許), CH(欧州特許), DE(欧州特許),

DK(欧州特許), ES(欧州特許), FR(欧州特許), GB(欧州特許),

GR(欧州特許),IT(欧州特許),JP,LU(欧州特許), MO(欧州特許),NL(欧州特許),SE(欧州特許),US.

特顏平 3/117418 1991年5月22日(22.05.91)

199145/1228(22. 05. 91)

添付公開書類

国際調査報告書

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 花王株式会社 (KAO CORPORATION) [JP/JP]

〒103 東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号 Tokyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出題人(米国についてのみ)

南 孝英(MINAMI, Takahide)[JP/JP]

〒640 和歌山県和歌山市湊1番地の1 第2ルネ湊102号

Wakayama, (JP)

能海洋子(NOUMI, Yoko)[JP/JP]

〒640 和歌山県和歌山市砂山南1丁目3番地の9

レディースマンション砂山南101号 Wakayama, (JP)

中村浩一(NAKAMURA, Koichi)[JP/JP]

〒273 千葉県船橋市山手2-9 花王社宅2-303 Chiba, (JP)

(74) 代理人

弁理士 古谷 馨,外(FURUYA, Kaoru et al.)

〒103 東京都中央区日本橋畑留町1-8-11 日本橋TMビル

Tokyo, (JP)

(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING BOTH OF ULTRAVIOLET-ABSORBENT SELF-DISPERSIBLE WATER-BASE VINYL RESIN AND FINE RESIN PARTICLE

(54) 発明の名称 衆外製吸収能を有する自己分散型水性ビニル樹脂の製造法及び食小樹脂粒子の製造法

#### (57) Abstract

A process for producing an emulsion of an ultraviolet-absorbent water-base vinyl resin or a fine particle thereof, which can be blended with a cosmetic base, etc., at high concentration, is highly safe and can exhibit sufficiently the effect as an ultraviolet absorber. An ultraviolet-absorbent self-dispersible water-base vinyl resin is obtained by conducting the solution polymerization of a monomer mixture containing as the essential components 20 to 95 wt % of a polymerizable monomer having a molar extinction coefficient of 10,000 or above and bearing an ultraviolet-absorbent group, such as a (meth)acrylamide monomer, a (meth)acrylate monomer or a substituted vinylbenzene monomer, respectively represented by general formulae (I), (II) or (III), and 80 to 5 wt % of a monomer bearing a salt-forming group, adding, if necessary, a neutralizing agent to the reaction mixture to ionize the salt-forming group, adding water to the resulting system, and distilling off the solvent to thereby cause phase inversion into a watery system. In formulae (I), (II), (II), R<sub>1</sub> represents hydrogen or methyl; R<sub>2</sub> represents hydrogen or C<sub>1</sub> to C<sub>4</sub> alkyl; and Y represents an ultraviolet-absorbent group. An ultraviolet-absorbent fine resin particle is obtained by dehydrating the above resin.

### (57) 要約

化粧料等の基材に配合する際に、高濃度に配合でき、しかも安全性が高く、紫外線吸収剤の効果を充分に発揮できる、紫外線吸収性の水性樹脂エマルジョン又は微粒子の製造法を提供する。下記一般式(I)~(III)で示される(メタ)アクリルアミド系単量体、(メタ)アクリル酸エステル系単量体、置換ビニルベンゼン系単量体等の分子吸光係数が10000以上の紫外線吸収能のある基を有する重合性単量体(a)20~95重量%及び塩生成基を有する単量体(b)5~80重量%を必須成分として含有する単量体混合物を用いて、溶剤中で溶液重合を行い、必要に応じ中和剤を加え塩生成基をイオン化し、続いて水を加えた後、溶剤を留去し水系に転相して紫外線吸収能を有する自己分散型水性ビニル樹脂を得る。更に、この自己分散型水性ビニル樹脂を脱水処理して紫外線吸収能を有する微小樹脂粒子を得る。

(式中、 $R_1$ は水素原子又はメチル基であり、 $R_2$ は水素原子又は炭素数  $1 \sim 4$  のアルキル基であり、Y は紫外線吸収能のある基を表す。)

#### 情報としての用途のみ

PCTに基づいて公開される国際出願のハンフレット第1頁にPCT加盟国を同定するために使用されるコード

		2.727
AT オーストリア	町 フィンランド	MN モンゴル
AU オーストラリア	FR フランス	MR モーリタニア
	GA ガボン	MW マラウイ
BB パルパードス	GA 7 4 2	NL オランダ
BE ベルギー	GN ギニア	
BF プルキナ・ファソ	GB イギリス	NO ノルウェー
BG フルガリア	GR ギリシャ	PL ポーランド
	HU ハンガリー	PT ホルトガル
BJ ベナン	10 77 77	RO ルーマニア
BR ブラジル	IE アイルランド	RU ロシア連邦
CA カナダ	IT イタリー	
CF 中央アッリカ共和国	JP 日本	SD スーダン
	KP 朝鮮民主主義人民共和国	SE スウェーデン
CG コンゴー	KR 大韓民國	SN セネガル
CH スイス	NA 人界区區	SU ソヴィエト連邦
CI コート・ジボアール	11 リヒテンシュタイン	
CM カメルーン	LK スリランカ	TD チャード
CS チェコスロバキア	LU ルクセンブルグ	TG トーゴ
	MC Eta	ひん ウクライナ
DB ドイツ	MC C/ A	US 米国
DK デンマーク	MG マタガスカル	OD 11-11
ES スペイン	ML マリ	

#### 明 細 書

紫外線吸収能を有する自己分散型水性ビニル樹脂の製造法及び微小樹脂粒子の製造法

### 〔産業上の利用分野〕

本発明は、均一で粒径の小さい紫外線吸収能を有する自己分散型水性ビニル樹脂の製造法及びその微小樹脂粒子の製造法に関するものである。

#### 〔従来の技術〕

紫外線は生物学的作用により長波長紫外線(UV-A: 波長  $320\sim400$ nm)、中波長紫外線(UV-B: 波長  $280\sim320$ nm)、短波長紫外線(UV-C: 波長  $190\sim280$ nm)に分けられるが、最もエネルギー的に高く、強力な殺菌作用を有するUV-Cは、地球をとりまくオゾン層により吸収され、地表に届く量は少ない。しかしフロンガスによるオゾン層の破壊により、最近ではUV-Cを含め地表に届く全紫外線量は増加している傾向にある。

照射量の多いUV-AとUV-Bはそれぞれ紅斑を起さず皮膚の黒化をもたらす(サンタン)現象、ほてりや水疱を作る(サンバーン)現象を引き起こす。これらの紫外線による害は、一時的な日焼けにとどまらず、長期的にはシワの多い皮膚を作り、いわゆる老化を促進したり、皮膚がんの因子となる他、光過敏症の誘発等が問題となっている。

従来より、これらの障害を予防するため、紫外線を吸収する吸収剤と、紫外線を反射、散乱させる散乱剤が目的や適用部位の条件に応じてクリーム、乳液、ローション、オイル、ゲル、粉体等の適当な剤型の化粧料中に配合されている。

これらに用いられる紫外線吸収剤としては、パラアミノ安息香酸エステル誘導体、ベンゾフェノン誘導体、ベンゾトリアゾール誘導体、桂皮酸エステル誘導体等があり、散乱剤としては、二酸化チタン、酸化亜鉛、酸化鉄、カオリン、タルク等がある。前者の紫外線吸収剤は、皮膚上への適用後、汗による流失、衣服への移行、体内への経皮吸収等により、短時間のうちに消失し易い。更に、そのもの自体が有する刺激性や皮膚透過性、及び光を受けた時に生じる一過性の刺激を皮膚にもたらす等の安全性に潜在的な問題がある。又後者の散乱剤は安全性は特に問題はないが紫外線だけを反射、散乱するような微粒子を製造することが難し

く、可視光の反射散乱による白ぼけや着色等の問題がある。このような理由から 上記の吸収剤や散乱剤の使用量が制限され、紫外線防御効果は必ずしも十分では ないのが現状である。

そこで、紫外線吸収剤の安全性を向上させる目的から高分子量の紫外線吸収剤 の開発が進んでいる。

このうち高分子主鎖中に紫外線吸収部位を有するものとして、特開下54-17134 (これはGB-A 2000679に対応する)及びUS-A 5086127に記載されてい ものが挙 げられるが、特殊な高分子であるため、製造上の困難性、溶解性が悪い等の欠点 を有している。

これに対し、高分子側鎖中に紫外線吸収部位を有するものとして、特公昭58-28250、US-A 4233430、US-A 3767690、US-A 4696969、及びEP-A 392882 に記載されているものが挙げられる。ところがこれらの高分子物質は一般に他の基剤との相溶性が悪く、更に水又は有機溶剤等に溶解して使用する場合には増粘が著しく、配合量に制限を受ける等の欠点を有している。

また高分子物質と従来の紫外線吸収剤とを、溶融混合したりマイクロカプセル化して複合化し、高濃度配合を可能にし、使用性を向上させようとする技術として、特公昭53-31932、特開平1-500756(これはEP-A 277211 に対応する)及びEP-A 369741 に記載されているものがある。しかしこれらの複合剤は均質なものを製造するために高コストになり、一般に粒径が大きく、紫外線吸収剤の効果を十分に引き出すことが難しいのが現状である。

#### [発明の開示]

上記状況の下、本発明者らは日焼け防止効果の持続性に優れ、白ぼけやてかり等がなく、且つ安全性が高く、化粧料にも使用可能な高分子紫外線吸収剤を開発すべく鋭意研究を行った結果、紫外線吸収部位の含有率が高く、且つ粒径が小さく、固形分の高い安定な水性エマルジョンを得ることができ、この水性エマルジョンが十分な日焼け防止効果の持続性を有し、白ぼけやてかり等がなく、化粧料への使用に耐える安全性の高いものであることを見出し本発明を完成した。

即ち本発明は、分子吸光係数が10000以上の紫外線吸収能のある基を有する重合性単量体(a) 20~95重量%及び塩生成基を有する単量体(b) 5~80重量%を必

領成分として含有する単量体混合物を用いて、溶剤中で溶液重合を行い、必要に応じ中和剤を加え塩生成基をイオン化し、続いて水を加えた後、溶剤を留去し水 系に転相することを特徴とする紫外線吸収能を有する自己分散型水性ビニル樹脂 の製造法を提供するものである。

更に得られた自己分散型水性ビニル樹脂を脱水処理することにより得られる微小樹脂粒子は、安全且つ汎用性に富む紫外線吸収能を有する粒子であり、化粧料等に使用することができる。従って、本発明は、上記の方法により得られる自己分散型水性ビニル樹脂を脱水処理することを特徴とする紫外線吸収能を有する微小樹脂粒子の製造法を提供するものである。

また、本発明は、分子吸光係数が10000 以上の紫外線吸収能のある基を有する 重合性単量体(a) 20~95重量%及び塩生成基を有する単量体(b) 5~80重量%を 必須成分として含有する単量体混合物を重合して得られる、粒径が 0.001~0.1 μm である紫外線吸収能を有する微小樹脂粒子を提供するものである。

本発明に用いられる分子吸光係数が10000 以上の紫外線吸収能のある基を有する重合性単量体(a) としては、下記一般式(I) ~(III) で表される(メタ) アクリルアミド系単量体、(メタ) アクリル酸エステル系単量体、置換ビニルベンゼン系単量体等が挙げられる。

$$CH_{2} = \begin{matrix} R_{1} \\ C \\ C \\ C - N - Y \\ 0 & R_{2} \end{matrix}$$
 (I)

(式中、 $R_1$ は水素原子又はメチル基であり、 $R_2$ は水素原子又は炭素数  $1 \sim 4$  のアルキル基であり、Y は紫外線吸収能のある基を表す。)

$$CH_{2} = \begin{matrix} R_{1} \\ C \\ C \\ C - 0 - Y \\ 0 \end{matrix}$$
 (11)

(式中、R<sub>1</sub>は水素原子又はメチル基であり、Yは紫外線吸収能のある基を表す。)

$$CH_2 = C \qquad (III)$$

(式中、 $R_1$ は水素原子又はメチル基であり、Yは紫外線吸収能のある基を表す。) 本発明において用いられる前記一般式(I)~(III)で表される分子吸光係数 が10000 以上の紫外線吸収能のある単量体(a) としては、例えば次に示す化合物 が挙げられるが、勿論これらに限定されず、またこれらの混合物であってもよい。

$$CH_{2} = \overset{C}{C} \\ \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & & & & & & \\ \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & & & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & & \\ & \overset{C}{C} - N \longrightarrow & \\ & \overset{C}{C}$$

 $CH_2 = \dot{C}$ 

$$CH_{2} = \overset{H}{\overset{1}{\text{C}}} - 0 - CH_{2}CH_{2}OCH_{2}CH_{2} - 0 - \overset{C}{\text{C}} - \overset{C}{\text{C}} - 0 - \overset{C}{\text{C}} + s)$$

$$CH_{2} = \overset{C}{\overset{1}{\text{C}}} - 0 - \overset{C}{\text{C}} + \overset{C}{\text{C}} - 0 - \overset{C}{\text{C}} + s$$

$$CH_{2} = \overset{C}{\overset{1}{\text{C}}} - 0 - CH_{2}CH_{2} - 0 - \overset{C}{\text{C}} - \overset{C}{\text{C}} - 0 - \overset{C}{\text{C}} + s$$

$$CH_{2} = \overset{C}{\overset{1}{\text{C}}} - 0 - CH_{2}CH_{2} - 0 - \overset{C}{\text{C}} - 0 - \overset{C}$$

$$CH_{2} = \begin{matrix} CH_{3} \\ C \\ C \\ C \\ OCH_{2}CH_{2}OCH_{2}CH_{2} - O - C - CH = CH - \bigcirc \bigcirc \bigcirc OCH_{3} \\ 0 \\ 0 \\ OCH_{3} \\ OCH_{3} \\ OCH_{4} \\ OCH_{5} \\ O$$

$$CH_{2} = \begin{matrix} CH_{3} & 0 & \\ CH_{2} & CH$$

$$CH_{2} = \overset{CH_{3}}{\overset{!}{\underset{0}{\text{C}}}} 0H$$

$$\overset{!}{\overset{!}{\underset{0}{\text{C}}}} 0 \overset{!}{\underset{0}{\text{N}}} N$$

$$CH_{2} = \begin{matrix} H \\ I \\ C \\ I \\ I \end{matrix} = 0$$

$$OH$$

$$N$$

$$N$$

$$CH_{2} = \begin{matrix} CH_{3} \\ C\\ C\\ C\\ 0 \end{matrix}$$

$$CH_{2}CH_{2}CH_{2}O - C$$

$$0H$$

$$0$$

$$0$$

$$CH_2 = \begin{matrix} H \\ C \\ C \\ C \\ O \\ O \end{matrix}$$

$$CH_2 CH_2 O - C \longrightarrow \begin{matrix} OH \\ N \\ N \end{matrix}$$

$$CH_{2} = \overset{H}{\overset{}{\overset{}{\overset{}{\bigcirc}}}} C$$

$$CH_{2}O \longrightarrow OH$$

$$CH_{N}OH$$

$$CH_2 = \overset{CH_3}{\overset{}{\downarrow}}$$

$$CH_2 = \overset{OH}{\overset{}{\downarrow}}$$

$$CH_2 = \overset{OH}{\overset{}{\downarrow}}$$

$$\begin{array}{c}
C = C \\
C - CH_2 - C \longrightarrow C(CH_3)_3 \\
0 & 0
\end{array}$$

$$CH_{2} = CH \xrightarrow{OH} CH_{2} = C$$

本発明に用いられる塩生成基を有する単量体(b) としては、アニオン性単量体、カチオン性単量体、両性単量体等があるが、これらの混合物であってもよい。 更に詳しくはアニオン性単量体としては、不飽和カルボン酸モノマー、不飽和スルホン酸モノマー、不飽和リン酸モノマー等があり、カチオン性単量体としては不飽和 3 級アミン含有モノマー、不飽和アンモニウム塩含有モノマー等があり、両性単量体としては、 N-(3-スルホプロピル)-N-メタクリロイルオキシエチル-N- ジメチルアンモニウムベタイン、 N-(3-スルホプロピル)-N-メタクリロイルアミノプロピル-N- ジメチルアンモニウムベタイン、 1-(3-スルホプロピル)-2-ビニルピリジニウムベタイン等がある。

具体的に説明すると、アニオン性単量体のうち不飽和カルボン酸モノマーとしては、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、イタコン酸、マレイン酸、フマール酸、シトラコン酸等、又はそれらの無水物及びそのモノアルキルエステルやカルボキシエチルビニルエーテル、カルボキシプロピルビニルエーテルの如きカルボキシル基を有するビニルエーテル類等がある。

不飽和スルホン酸モノマーとしては、スチレンスルホン酸、2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸、3-スルホプロピル(メタ)アクリル酸エステル、ビス-(3-スルホプロピル)-イタコン酸エステル等及びその塩がある。又、その他2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリル酸の硫酸モノエステル及びその塩がある。

不飽和リン酸モノマーとしては、ビニルホスホン酸、ビニルホスフェート、アシッドホスホキシエチル(メタ)アクリレート、3-クロロ-2-アシッドホスホキ

シプロピル (メタ) アクリレート、アシッドホスホキシプロピル (メタ) アクリレート、ビス (メタアクリロイロキシエチル) ホスフェート、ジフェニルー 2-メタクリロイロキシエチルホスフェート、ジフェニルー 2-アクリロイロキシエチルホスフェート、ジブチルー 2-アクリロイロキシエチルホスフェート、ジブチルー 2-アクリロイロキシエチルホスフェート、ジオクチルー2-(メタ) アクリロイロキシエチルホスフェート等がある。

カチオン性単量体としては、不飽和3級アミン含有モノマー及び不飽和アンモ ニウム塩含有モノマー等があるが、具体的には、ビニルピリジン、2-メチル-5-ビニルピリジン、2-エチル-5- ビニルピリジンの如きモノビニルピリジン類; N. N-ジメチルアミノスチレン、N.N-ジメチルアミノメチルスチレンの如きジアルキ ルアミノ基を有するスチレン類: N, N-ジメチルアミノエチルメタクリレート、N, N-ジメチルアミノエチルアクリレート、N, N-ジエチルアミノエチルメタクリレー ト、N,N-ジエチルアミノエチルアクリレート、N,N-ジメチルアミノプロピルメタ クリレート、N. N-ジメチルアミノプロピルアクリレート、N, N-ジエチルアミノプ ロピルメタクリレート、N.N-ジエチルアミノプロピルアクリレートの如きアクリ ル酸又はメタクリル酸のジアルキルアミノ基を有するエステル類:2-ジメチルア ミノエチルビニルエーテルの如きジアルキルアミノ基を有するビニルエーテル類 : N-(N', N'- ジメチルアミノエチル) メタクリルアミド、N-(N', N'- ジメチルア ミノエチル) アクリルアミド、N-(N',N'- ジエチルアミノエチル) メタクリルア ミド、N-(N', N'- ジエチルアミノエチル) アクリルアミド、N-(N', N'- ジメチル アミノプロピル) メタクリルアミド、N-(N'-, N' - ジメチルアミノプロピル) アク リルアミド、N-(N',N'- ジエチルアミノプロピル) メタクリルアミド、N-(N',N' - ジエチルアミノプロピル) アクリルアミドの如きジアルキルアミノ基を有する アクリルアミドあるいはメタクリルアミド類、或いはこれらをハロゲン化アルキ ル (アルキル基の炭素数1ないし18、ハロゲンとして塩素、臭素、ヨウ素)、ハ ロゲン化ベンジル、例えば塩化ベンジルまたは臭化ベンジル、アルキルまたはア リールスルホン酸、例えばメタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸またはトルエ ンスルホン酸のアルキルエステル(アルキル基の炭素数1ないし18)、および硫 酸ジアルキル(アルキル基の炭素数1ないし4)の如き公知の四級化剤で四級化 したもの等が挙げられる。

本発明に用いられる単量体混合物中の、紫外線吸収能のある基を有する重合性 単量体(a)及び塩生成基を有する単量体(b)の配合割合は前者20~95重量%、後 者5~80重量%である。紫外線吸収能のある基を有する重合性単量体(a)の量が 20重量%未満では紫外線吸収剤としての効果を充分に発揮できず、95重量%を越 えると均一で安定な粒径の小さい自己分散型水性樹脂が得られない。また塩生成 基を有する単量体(b)の量が5重量%未満では安定な自己分散型水性 対脂が得ら れず、80重量%を越えると耐水性の良い微小樹脂粒子が得られない。

本発明に用いられる単量体混合物は、上記単量体(a) 及び(b) を必須成分とするが、更にこれら単量体と重合可能な他の単量体(c) を最大75重量%まで含有しても良い。

本発明に用いられる他の単量体(c) としては、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸イソプロピル、アクリル酸n-ブチル、アクリル酸イソプチル、アクリル酸n-アミル、アクリル酸n-マミル、アクリル酸n-マミル、アクリル酸n-マミル、アクリル酸n-マミル、アクリル酸デシル、アクリル酸デシル、アクリル酸デシル、アクリル酸デシル、アクリル酸エステル類、メタクリル酸メチル、メタクリル酸イソプチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸n-プチル、メタクリル酸イソプチル、メタクリル酸n-アミル、メタクリル酸n-マミル、メタクリル酸n-オクチル、メタクリル酸n-オクチル、メタクリル酸2-エチルへキシル、メタクリル酸デシル、メタクリル酸ドデシルなどのメタクリル酸2-エチルへキシル、メタクリル酸デシル、メタクリル酸ドデシルなどのメタクリル酸エステル類、スチレン、ビニルトルエン、2-メチルスチレン、1-プチルスチレン、クロルスチレンなどのスチレン系モノマー、アクリル酸ヒドロキシプロピルなどのヒドロキシ基含有モノマー、アクリル酸グリシジル、メタクリル酸グリシジルなどのエポキシ基含有モノマー、アクリル酸グリシジル、メタクリル酸グリシジルなどのエポキシ基含有モノマー、ア、次の式

 $CH_2 = CHCOOC_2H_4 - (CF_2)_6 H$ ,  $CH_2 = CHCOOC_2H_4 - (CF_2)_8 H$ 

 $CH_2=C(CH_3)COOC_2H_4$   $-(CF_2)_6$  H、 $CH_2=C(CH_3)COOC_2H_4$   $-(CF_2)_8$  H 等で示されるフッ化アルキル基を結合した(メタ)アクリル酸エステル、並びにアクリロニトリルなどの1種又は2種以上から選択することができる。

本発明においては、溶液重合の溶媒として水系への転相をスムースに行わせることのできるアルコール系溶剤、ケトン系溶剤、エーテル系溶剤を用いる。

本発明に用いられるアルコール系溶剤としては、例えばメタノール エタノール、n-プロパノール、イソプロパノール、n-ブタノール、第2級ブタ ール、第3級ブタノール、イソブタノール、ジアセトンアルコール、2-イミノエタノール 等が挙げられ、好ましくはイソプロパノールである。

又、ケトン系溶剤としては、例えばアセトン、メチルエチルケトン、ジエチルケトン、ジプロピルケトン、メチルイソプチルケトン、メチルイソプロピルケトン等が挙げられ、好ましくは、メチルエチルケトンである。

またエーテル系溶剤としては、例えばテトラヒドロフラン、ジオキサン等が挙げられ、好ましくはテトラヒドロフランである。

これらの溶剤は1種又は2種以上混合して用いられる。必要によっては高沸点 親水性有機溶剤を併用してもよい。

高沸点親水性有機溶剤としては、フェノキシエタノール、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、3-メチル-3-メトキシブタノール等があるが、これらに限られるものではない。

本発明の溶液重合の開始剤としては、公知のラジカル開始剤が用いられる。例えば、t-ブチルヒドロペルオキシドに代表されるヒドロ過酸化物類、過酸化ジャプチルに代表される過酸化ジャルキル類、過酸化アセチルに代表される過酸化ジャンル類、過酢酸t-ブチルに代表される過酸エステル類、メチルエチルケトンペルオキシドに代表されるケトンペルオキシド類、及び2,2- アゾビス(イソブチロニトリル)、2,2- アゾビス(2-メチルブチロニトリル)、2,2- アゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)、1,1- アゾビス(シクロヘキサン-1- カルボ

ニトリル) 等に代表されるアゾ重合開始剤が挙げられる。

前記各原料を使用して均一で安定な自己分散型水性ビニル樹脂分散物を得るに は、例えば、撹拌機、還流冷却器、滴下ロート、温度計、チッ素ガス導入管のつ いた反応器を準備し、分子吸光係数が10000 以上の紫外線吸収能のある基を有す る重合性単量体(a) 20~95重量%、好ましくは30~90重量%、及び塩生成基を有 する単量体(b) 5~80重量%、好ましくほ10~70重量%を必須成分として含有す る単量体混合物と、ラジカル開始剤を全モノマーに対し0.05~0.5 重量%、及び 必要によっては連鎖移動剤を用い、アルコール系、ケトン系及びエーテル系溶剤 の一種又は二種以上を全重合性単量体100 重量部に対し 200~2000重量部、好ま しくは 300~1500重量部用いチッ素ガス気流中で50℃~溶剤還流下で、1~30時 間溶液重合させる。ここで、均質な共重合体を得る方法としては、可能な限り反 応系中のモノマー比率を一定に保つようにモノマーの滴下速度をコントロールす ることが好ましい。具体的には、共重合性がとぼしく反応速度の遅いモノマーを 初期にその全量又は一部を反応器中に仕込み、反応速度の速いモノマー等を反応 器中に滴下するか、又は、反応速度の遅いモノマーと反応速度の速いモノマーの 一部を反応器中に仕込み、この組成を可能な限り一定に保ち反応速度の速いモノ マーの消費速度にあわせ、反応速度の速いモノマーを滴下すること等により均質 な共重合体が得られる。

その後、必要であれば再沈澱や膜等による精製を行い、残モノマーを1%未満、好ましくは0.5%未満にし、溶媒に再溶解する。次にこの共重合体の溶液に、必要に応じて、中和剤または中和剤の水溶液を攪拌しながら徐々に加え塩生成基をイオン化する。すでにイオン化されている場合、即ち、両性単量体のように最初からイオン基を有している単量体、例えば N-(3-スルホプロピル)-N-メタクリロイルオキシエチル-N,N-ジメチルアンモニウムベタイン等を用いて得られたものであれば中和する必要はない。

ここで用いる中和剤としては、公知の酸、塩基が用いられる。塩生成基を有するモノマーが酸基を有する場合は、中和剤として塩基が用いられ、塩生成基を有するモノマーが塩基を有する場合は中和剤として酸が用いられる。中和剤として用いられる塩基としては、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リ

チウム等の無機水酸化物、ジメチルアニリン、トリエタノールアミン、トリエチルアミン、ジメチルアニリン等の3級アミン類、アンモニア等が挙げられる。中和剤として用いられる酸としては、例えば塩酸、硫酸等の無機酸、酢酸、プロピオン酸、乳酸、コハク酸、グリコール酸等の有機酸が挙げられる。中和度に特に制限はないが、得られた水性ビニル樹脂のpHが中性付近で、かつ透明性が高くなるように中和するのが望ましい。

続いて徐々に水を加えることにより、一旦増粘したものが急激に減粘して粘度が低下した状態になるまで水を加え、次にアルコール系及び/又はケトン系及び/又はエーテル系溶剤を留去し水系に転相し、更に濃縮して、固形分が10~50重量%の均一で安定な自己分散型水性ビニル樹脂分散物が得られる。

本発明で得られる自己分散型水性ビニル樹脂の重量平均分子量は 1,000~500,000 が好適である。この理由は 1,000未満では光安定性や経皮吸収性等で低分子化合物と同等となるおそれがあり、また500,000 を越えると高粘度となり転相工程等で支障をきたし、高濃度で安定な自己分散型水性ビニル樹脂が得られない。

このような本発明で得られた自己分散型水性ビニル樹脂は可視光線の透過率が50~95%の透明性を有しており、レーザー光を照射するとコロイド特有のチンダル現象を呈する性質を有している。

本発明で得られた、均一で安定な自己分散型水性ビニル樹脂の粒径は、0.001  $\sim 0.1~\mu m$  、主には $0.01 \sim 0.1~\mu m$  である。

上記の如き方法で得られた自己分散型水性ビニル樹脂分散物を脱水処理することにより紫外線吸収能を有する上記粒径の微小樹脂粒子が得られる。脱水処理方法は特に限定されず、凍結乾燥等の従来公知の方法を用いることができる。

本発明で得られる自己分散型水性ビニル樹脂又はその微小樹脂粒子は、クリーム、乳液、ローション、オイル、ゲル、粉体等の適当な剤型の化粧料の中に、高 濃度に配合でき、しかも安全性が高く、紫外線吸収剤としての効果を充分に発揮 できる。

本発明によって得られる紫外線吸収能を有する自己分散型水性ビニル樹脂は、 粒径サイズが均一で、高温放置安定性、希釈安定性、機械的安定性、耐水性に優れ、紫外線吸収能が良好で、かつ残モノマー量が少ないため安全性が高いもので ある。

従って、本発明によって得られる紫外線吸収能を有する自己分散型水性ビニル樹脂エマルジョンは化粧水、化粧乳液、あるいは頭髪保護のための整髪料、シャンプー、リンス等に適当量配合し用いられる。またこの水性樹脂エマルジョンを脱水処理して得られる紫外線吸収能を有する微小樹脂粒子はファンデーション基材中に練りこんだり、水性基材に再分散して用いられる。

### 〔実施例〕

次に実施例、比較例を掲げて本発明を具体的に説明するが、本発明がこれらに 限定されないことは勿論である。なお、例中の部及び%は特記しない限り全て重 量基準である。

#### 実施例-1

撹拌機、還流冷却器、滴下ロート、温度計、チッ素導入管のついた反応器にメ チルエチルケトン 115部、次式

で示される紫外線吸収性モノマー 100部、メタクリル酸 7 部を仕込み、チッ素ガスを流し溶存酸素を除去する。

一方、滴下ロートに溶存酸素を除去したメチルエチルケトン 115部と、メタクリル酸 9 部及び2,2'-アゾビス (2-メチルプチロニトリル)(V-59、和光純薬工業(株)製、以下、V-59と略記する)0.2 部を仕込む。

反応器を $83\pm3$  ℃に加熱後、V-59 0.4 部をメチルエチルケトン 115部に溶解 したものを加え、滴下ロートよりメタクリル酸の消費速度にあわせてモノマー溶液を滴下する。滴下終了後、更に 3 時間熟成、再びV-59 0.1 部をメチルエチルケトン 115部に溶解したものを加え、再び 2 時間反応を続け均質な共重合体溶液を得た。

次にこの共重合体溶液に1規定水酸化ナトリウム水溶液 170部を加え中和し、 続いてイオン交換水 830部を加えた後、減圧下40℃でメチルエチルケトンを留去 し、透明な紫外線吸収能を有する自己分散型水性ビニル樹脂エマルジョンを得た。 さらにこのエマルジョンを凍結乾燥することにより一次粒子径が0.02μm 以下 の白色微粒子を得た。

### 実施例-2

実施例-1と同様にメチルエチルケトン 110部、次式

$$CH_{2} = \begin{matrix} H \\ C \\ C \\ C \\ -N - CH_{2}CH_{2} - 0 - C \\ 0 \end{matrix} - N(C_{2}H_{5})_{2}$$

で示される紫外線吸収性モノマー80部、n-ブチルアクリレート10部、アクリル酸 9 部を仕込み、チッ素ガスを流し溶存酸素を除去する。

一方、滴下ロートに溶存酸素を除去したメチルエチルケトン 115部と、 $n-\vec{r}$  チルアクリレート10部及びV-59 0.2 部を仕込む。

反応器を $83\pm3$   $^{\circ}$  に加熱後、V-59 0.3 部をメチルエチルケトン 115部に溶解 したものを加え、滴下ロートよりn-ブチルアクリレートの消費速度にあわせて モノマー溶液を滴下する。滴下終了後、V-59 0.1 部をメチルエチルケトン 115 部に溶解したものを加え、5 時間反応を続け均質な共重合体溶液を得た。

次にアセトン:エタノール=1:1(重量比)の溶媒に共重合体溶液を滴下し、再沈澱精製を行った後、再びメチルエチルケトン350部に溶解した。

次にこの共重合体溶液に1規定水酸化ナトリウム水溶液 130部を加え中和し、 続いてイオン交換水 870部を加え実施例-1と同様の処方で透明な紫外線吸収能 を有する自己分散型水性ビニル樹脂エマルジョンを得た。

さらにこのエマルジョンを凍結乾燥することにより一次粒子径が $0.03\,\mu\,\mathrm{m}$  の白色微粒子を得た。

#### 実施例-3

実施例-1と同様にイソプロピルアルコール60部、メチルエチルケトン60部、 次式

$$CH_2 = \begin{matrix} CH_3 & OH & II \\ C & OH & II \\ C - N & C \\ II & I \\ O & H \end{matrix}$$

で示される紫外線吸収性モノマー50部、メチルメタクリレート20部、メタクリル酸10部を仕込みチッ素ガスを流し溶存酸素を除去する。

一方、滴下ロートに溶存酸素を除去したイソプロピルアルコール60部、メチルエチルケトン60部とメチルメタクリレート30部及びV-59 0.2 部を仕込む。

反応器を83±3℃に加熱後、V-59 0.4 部をイソプロピルアルコール60部、メチルエチルケトン60部に溶解したものを加え、滴下ロートよりメチルメタクリレートの消費速度にあわせてモノマー溶液を滴下する。滴下終了後、V-59 0.1 部をイソプロピルアルコール60部、メチルエチルケトン60部に溶解したものを加え、5時間反応を続け均質な共重合体溶液を得た。

次にこの共重合体溶液にトリエチルアミン6部を加え中和し、続いてイオン交換水1000部を加えた後、減圧下50℃でイソプロピルアルコールとメチルエチルケトンを留去し、透明な紫外線吸収能を有する自己分散型水性ビニル樹脂エマルジョンを得た。

さらにこのエマルジョンを40℃で真空乾燥することにより一次粒子径が $0.03\,\mu$ m の白色微粒子を得た。

#### 実施例-4

実施例-1と同様にメチルエチルケトン: 115部、次式

$$CH_{2} = \begin{matrix} CH_{3} \\ CH_{2} = \begin{matrix} C \\ C \\ C \\ -N - CH_{2} \end{matrix} \qquad \begin{matrix} OH \\ N \\ N \end{matrix}$$

で示される紫外線吸収性モノマー60部とn-ブチルアクリレート20部及びメタクリル酸10部を仕込み、チッ素ガスを流し溶存酸素を除去する。

一方、滴下ロートに溶存酸素を除去したメチルエチルケトン 115部、n-プチルアクリレート20部及びV-59 0.2 部を仕込む。

反応器を83±3℃に加熱後、V-59 0.3 部をメチルエチルケトン 115部に溶解 したものを加え、滴下ロートよりn-ブチルアクリレートの消費速度にあわせて モノマー溶液を滴下する。滴下終了後、V-59 0.1 部をメチルエチルケトン 115 部に溶解したものを加え5時間反応を続け均質な共重合体溶液を得た。

次にこの共重合体溶液に1規定水酸化ナトリウム水溶液80部を加え中和し、続いてイオン交換水 920部を加え、実施例-1と同様の処方で透明な紫外線吸収能を有する自己分散型水性ビニル樹脂エマルジョンを得た。

さらにこのエマルジョンを凍結乾燥することにより一次粒子径が0.02μm の白色微粒子を得た。

#### 実施例-5

実施例-1と同様にイソプロピルアルコール60部、メチルエチルケトン60部、 次式

$$CH_{2} = \begin{matrix} CH_{3} \\ C\\ C\\ C\\ -N - CH_{2}CH_{2} - 0 - C \end{matrix} \longrightarrow N(CH_{3})_{2}$$

$$\begin{matrix} II & I & I & I \\ I & I & I \\ 0 & H & 0 \end{matrix}$$

で示される紫外線吸収性モノマー70部、スチレン30部、メタクリル酸 9 部を仕込み、チッ素ガスを流し溶存酸素を除去する。

一方、滴下ロートに溶存酸素を除去したイソプロピルアルコール60部、メチルエチルケトン60部とメタクリル酸12部及びV-59 0.4 部を仕込む。

反応器を83±3℃に加熱後、V-59 0.2 部をイソプロピルアルコール60部、メチルエチルケトン60部に溶解したものを加え、滴下ロートよりメタクリル酸の消費速度にあわせてモノマー溶液を滴下する。滴下終了後、V-59 0.1 部をイソプロピルアルコール60部、メチルエチルケトン60部に溶解したものを加え、8時間反応を続け均質な共重合体溶液を得た。

次にこの共重合体溶液に1規定水酸化ナトリウム水溶液 250部を加え中和し、 続いてイオン交換水 750部を加えた後、減圧下50℃でイソプロピルアルコールと メチルエチルケトンを留去し、透明な紫外線吸収能を有する自己分散型水性ビニ ル樹脂エマルジョンを得た。 さらにこのエマルジョンを凍結乾燥することにより一次粒子径が $0.09 \, \mu \, \mathrm{m}$  の白色微粒子を得た。

### 実施例6

紫外線吸収性モノマーとして次式

で示されるモノマー50部及び次式

$$CH_{2} = C$$

$$CH_{2} = C$$

$$C - N - CH_{2}CH_{2} - O - C$$

$$0 + N - CH_{3}CH_{3} - O - C$$

$$0 + N - CH_{3}CH_{3} - O - C$$

$$0 + N - CH_{3}CH_{3} - O - C$$

で示されるモノマー50部を用いる以外は実施例1と同様にして透明な紫外線吸収能を有する自己分散型水性ビニル樹脂エマルジョンを得た。

さらにこのエマルジョンを凍結乾燥することにより一次粒子径が $0.03 \mu m$  の白色微粒子を得た。

#### 実施例7

実施例1と同様の反応器に紫外線吸収性モノマーとして、次式

で示されるモノマー100 部、メタクリル酸23部と、メチルエチルケトン1260部、 イソプロパノール280 部を仕込み、チッ素ガスを流し溶存酸素を除去する。

一方、滴下ロートに溶存酸素を除去したメチルエチルケトン58部、イソプロパノール33部、メタクリル酸22部、V-59 0.7 部を仕込む。

反応器を76℃に加熱後、V-59 0.3 部をメチルエチルケトン37部、イソプロパノール23部に溶解したものを加え、滴下ロートよりメタクリル酸の消費速度にあ

わせてモノマー溶液を滴下する。滴下終了後、20時間反応を続け均質な共重合体 溶液を得た。

次にメチルエチルケトン: ヘキサン= 2:1 (重量比)の溶媒に共重合体溶液 を滴下し、再沈澱精製を行った後、再びメチルエチルケトン266 部、イソプロパ ノール134 部に溶解した。

次にこの共重合体溶液に1規定水酸化ナトリウム水溶液 352部を加え中和し、 続いてイオン交換水 600部を加えた後、減圧下、40℃で溶剤及び水の一部を留去 し透明な紫外線吸収能を有する自己分散型水性ビニル樹脂エマルジョンを得た。

さらにこのエマルジョンを凍結乾燥することにより一次粒子径が0.03 µm の白色微粒子を得た。

#### 実施例8

実施例1と同様の反応器に紫外線吸収性モノマーとして、次式

$$CH_{2} = \begin{matrix} CH_{3} & 0 & \\ I & C & C & C \\ C & C & C & C \\ I & C & OH \end{matrix}$$

で示されるモノマー100 部、メタクリル酸20部と、メチルエチルケトン1000部、 イソプロパノール240 部を仕込み、チッ素ガスを流し溶存酸素を除去する。

一方、滴下ロートに溶存酸素を除去したメチルエチルケトン55部、イソプロパ ノール30部、メタクリル酸18部、V-59 0.5 部を仕込む。

反応器を76℃に加熱後、V-59 0.4 部をメチルエチルケトン39部、イソプロパノール25部に溶解したものを加え、滴下ロートよりメタクリル酸の消費速度にあわせてモノマー溶液を滴下する。滴下終了後、15時間反応を続け均質な共重合体溶液を得た。

次にメチルエチルケトン: ヘキサン=2:1 (重量比)の溶媒に共重合体溶液 を滴下し、再沈殿精製を行った後、再びメチルエチルケトン270 部、イソプロパ ノール135 部に溶解した。

次にこの共重合体溶液に1規定水酸化ナトリウム水溶液 365部を加え中和し、 続いてイオン交換水 650部を加えた後、減圧下、40℃で溶剤及び水の一部を留去 し透明な紫外線吸収能を有する自己分散型水性ビニル樹脂エマルジョンを得た。 さらにこのエマルジョンを凍結乾燥することにより一次粒子径が $0.04\,\mu\,\mathrm{m}$  の白色微粒子を得た。

### 実施例9

実施例1と同様の反応器に紫外線吸収性モノマーとして、次式

$$CH_{2} = \begin{matrix} CH_{3} \\ C \\ C \\ C \\ -0 - CH_{2}CH_{2} - 0 - C - CH = CH \end{matrix} \longrightarrow OCH_{3}$$

で示されるモノマー50部、及び次式

$$CH_{2} = \overset{C}{\overset{1}{\overset{1}{\text{C}}}} = \overset{0}{\overset{1}{\overset{1}{\text{C}}}} - 0 - CH_{2}CH_{2} - 0 - C \xrightarrow{\overset{1}{\overset{1}{\text{C}}}} \overset{0}{\overset{1}{\overset{1}{\text{C}}}} = \overset{0}{\overset{1}{\overset{1}{$$

で示されるモノマー50部、メタクリル酸30部と、メチルエチルケトン950 部、イソプロパノール200 部を仕込み、チッ素ガスを流し溶存酸素を除去する。

一方、滴下ロートに溶存酸素を除去したメチルエチルケトン60部、イソプロパノール30部、メタクリル酸20部、V-59 0.6 部を仕込む。

反応器を76℃に加熱後、V-59 0.3 部をメチルエチルケトン40部、イソプロパノール25部に溶解したものを加え、滴下ロートよりメタクリル酸の消費速度にあわせてモノマー溶液を滴下する。滴下終了後、16時間反応を続け均質な共重合体溶液を得た。

次にメチルエチルケトン: ヘキサン=2:1 (重量比)の溶媒に共重合体溶液を滴下し、再沈澱精製を行った後、再びメチルエチルケトン280 部、イソプロパノール140 部に溶解した。

次にこの共重合体溶液に1規定水酸化ナトリウム水溶液 405部を加え中和し、 続いてイオン交換水 700部を加えた後、減圧下、40℃で溶剤及び水の一部を留去 し透明な紫外線吸収能を有する自己分散型水性ビニル樹脂エマルジョンを得た。 さらにこのエマルジョンを凍結乾燥することにより一次粒子径が0.04μm の白

: .

色微粒子を得た。

### 実施例10

実施例1と同様の反応器に紫外線吸収性モノマーとして、次式

で示されるモノマー100 部、メチルメタクリレート103 部、ジメチルアミノプロ ピルメタクリルアミド59部と、メチルエチルケトン1380部を仕込み、チッ素ガス を流し溶存酸素を除去する。

一方、滴下ロートに溶存酸素を除去したメチルエチルケトン900 部、V-59 2 部を仕込む。

反応器を79℃に加熱後、滴下ロートより開始剤溶液を滴下する。滴下終了後、 24時間反応を続け均質な共重合体溶液を得た。

次に共重合体溶液をメチルエチルケトンで希釈し、セラミックフィルターを用いて残モノマーを除去した後、固形分20%まで濃縮する。

次にこの共重合体溶液に1規定塩酸水溶液 207部を加え中和し、続いてイオン 交換水 700部を加えた後、減圧下、40℃で溶剤及び水の一部を留去し透明な紫外 線吸収能を有する自己分散型水性ビニル樹脂エマルジョンを得た。

さらにこのエマルジョンを凍結乾燥することにより一次粒子径が $0.05 \mu m$  の白色微粒子を得た。

#### 実施例11

実施例1と同様の反応器に紫外線吸収性モノマーとして、次式

$$CH_2 = CH \longrightarrow C \longrightarrow C \longrightarrow C$$

で示されるモノマー100 部、メタクリル酸 8 部と、メチルエチルケトン500 部を 仕込み、チッ素ガスを流し溶存酸素を除去する。

一方、滴下ロートに溶存酸素を除去したメチルエチルケトン200部、メタクリ

ル酸10部、V-59 0.2 部を仕込む。

反応器を82℃に加熱後、V-59 0.4 部をメチルエチルケトン200 部に溶解したものを加え、滴下ロートよりメタクリル酸の消費速度にあわせてモノマー溶液を滴下する。滴下終了後、4時間反応を続け、再びV-59 0.1 部をメチルエチルケトン200 部に溶解したものを加え、更に2時間反応を続け均質な共重合体溶液を得た。

次にこの共重合体溶液に1規定水酸化ナトリウム水溶液 180部を加え中和し、 続いてイオン交換水 900部を加えた後、減圧下、40℃でメチルエチルケトンと水 の一部を留去し透明な紫外線吸収能を有する自己分散型水性ビニル樹脂エマルジョンを得た。

さらにこのエマルジョンを凍結乾燥することにより一次粒子径が0.02μm の白色微粒子を得た。

10

### 実施例12

実施例1と同様の反応器に紫外線吸収性モノマーとして、次式

$$CH_2 = CH$$

$$OH$$

$$N$$

で示されるモノマー100 部、メタクリル酸7部と、メチルエチルケトン120 部を 仕込み、チッ素ガスを流し溶存酸素を除去する。

一方、滴下ロートに溶存酸素を除去したメチルエチルケトン120 部、メタクリル酸9部、V-59 0.2 部を仕込む。

反応器を83℃に加熱後、V-59 0.4 部をメチルエチルケトン200 部に溶解したものを加え、滴下ロートよりメタクリル酸の消費速度にあわせてモノマー溶液を滴下する。滴下終了後、3時間反応を続け、再びV-59 0.1 部をメチルエチルケトン120 部に溶解したものを加え、更に2時間反応を続け均質な共重合体溶液を得た。

次にこの共重合体溶液に1規定水酸化ナトリウム水溶液 150部を加え中和し、 続いてイオン交換水 900部を加えた後、減圧下、40℃でメチルエチルケトンと水 の一部を留去し透明な紫外線吸収能を有する自己分散型水性ビニル樹脂エマルジ ョンを得た。

さらにこのエマルジョンを凍結乾燥することにより一次粒子径が0.03μm の白 色微粒子を得た。

### 比較例-1

撹拌機、還流冷却器、滴下ロート、温度計、チッ素導入管のついた反応器にメ チルエチルケトン 115部、次式

で示される紫外線吸収性モノマー50部、メタクリル酸 150部を仕込み、チッ素ガスを流し溶存酸素を除去する。

一方、滴下ロートに溶存酸素を除去したメチルエチルケトン 115部と、メタクリル酸 100部及びV-59 0.2 部を仕込む。

反応器を $83\pm3$   $^{\circ}$  に加熱後、V-59 0.4 部をメチルエチルケトン 115部に溶解 したものを加え、滴下ロートよりメタクリル酸の消費速度にあわせてモノマー溶液を滴下する。滴下終了後、更に 3 時間熟成、再びV-59 0.1 部をメチルエチルケトン 115部に溶解したものを加え、再び 2 時間反応を続け均質な共重合体溶液を得た。

得られた共重合体溶液を、1規定水酸化ナトリウム水溶液を2000部用い、イオン交換水の追加がないこと以外は実施例-1と同様に処理し自己分散型水性ビニル樹脂エマルジョン及び一次粒子径0.01μm以下の白色微粒子を得た。

### 比較例-2

撹拌機、還流冷却器、滴下ロート、温度計、チッ素導入管のついた反応器にメ チルエチルケトン 115部、次式

で示される紫外線吸収性モノマー 100部、メタクリル酸 2 部を仕込み、チッ素ガスを流し溶存酸素を除去する。

一方、滴下ロートに溶存酸素を除去したメチルエチルケトン 115部と、メタクリル酸 2 部及びV-59 0.2 部を仕込む。

反応器を $83\pm3$   $^{\circ}$  に加熱後、V-59 0.4 部をメチルエチルケトン 115部に溶解したものを加え、滴下ロートよりメタクリル酸の消費速度にあわせてモノマー溶液を滴下する。滴下終了後、更に 3 時間熟成、再びV-59 0.1 部をメチルエチルケトン 115部に溶解したものを加え、再び 2 時間反応を続け均質な共重合体溶液を得た。

得られた共重合体溶液を、1規定水酸化ナトリウム水溶液を48部用い、イオン 交換水を1000部用いること以外は実施例-1と同様に処理し自己分散型水性ビニ ル樹脂エマルジョン及び一次粒子径0.2 μm の白色微粒子を得た。

### 比較例-3

撹拌機、還流冷却器、滴下ロート、温度計、チッ素導入管のついた反応器に水325 部、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル(エチレンオキサイド25モル付加)5部及び過硫酸カリウム2部を仕込む。

#### 一方、滴下ロートに次式

$$CH_{2} = \begin{matrix} CH_{3} \\ C\\ C\\ C\\ N \end{matrix} \longrightarrow \begin{matrix} C - 0C_{2}H_{5} \end{matrix}$$

で示される紫外線吸収性モノマー50部、メタクリル酸15部及びシクロヘキサン70 部を溶解して仕込む。その後チッ素を毎分10ccの速度で導入し、200rpmで撹拌しながら滴下ロートからモノマー溶液を毎分5部ずつ添加しながら乳化重合反応を行なった。全モノマー溶液を添加後4時間熟成を行い重合反応を終了する。その後共沸によりシクロヘキサンを除去し、白濁した乳化重合エマルジョンを得た。さらにこのエマルジョンを凍結乾燥し一次粒子径0.7 μm の白色微粒子を得た。

実施例1~12及び比較例1~3で得られた水性樹脂エマルジョンについて以下に示す方法により物性を評価した。その結果を表1に示す。

## 物性評価方法

(1) 粒 径

COULTER ELECTRONICS INC 製のCOULTER MODEL N4で測定

(2) 性 状

水性樹脂エマルジョンの肉眼で観察した性状を記述

(3) 高温放置安定性

水性樹脂エマルジョンを温度40℃±2℃に保った恒温器に1ヶ月間放置した後、外観の状態を観察し、○、△、×の三段階に区別した。

〇:全く不変

△:40℃下で1週間以上安定で、40℃下で1ヶ月以内に増粘もしくは沈殿物 発生

×:40℃下で1週間以内に分離ないしは多量の沈殿物発生

(4) 希釈安定性

水性樹脂エマルジョンを樹脂分1%になるように蒸留水で希釈し、これを内径7mm、長さ30cmのガラス管に入れて密栓し、24時間後の状態を観察し、〇、 Δ、×の三段階に区別した。

〇:分離、沈降認められず均一

△:少量の沈降認められるが、実用レベル内

×:分離、沈降物多く実用レベル外

(5) 機械的安定性(マーロン試験器)

マーロン試験器受器に水性樹脂エマルジョン 100gを入れ、荷重10kgで5分間撹拌後、水性樹脂エマルジョンを 100メッシュ金網で濾過し、凝集物を 105℃で3時間乾燥し重量を求め、下記式にて機械的安定性を求める。

(6) 耐水性

テフロンコーティング皿に水性樹脂エマルジョンを入れ乾燥して得たフィルムを25℃の水中に1日間浸漬し、状態の変化を観察した。

○:塗膜の膨潤率5%以内で白化等の変化のないもの

△:塗膜の膨潤率5%~10%で白化等の変化のないもの及び若干白化するもの

×:塗膜の膨潤率10%以上で白化等表面変化の大きいもの

### (7) 紫外線吸収性

分光光度計(UV-265FW(株)島津製作所製)により、水性樹脂エマルジョンの 吸光度スペクトルを測定し、最大吸収波長( $\lambda_{max}$ )と吸光係数( $\varepsilon$ )を測定した。

### (8) 耐候性

ソーラーシミュレーター (サンシャインスーパーロングライフウェザーメーター, スガ試験機 (株)製)により、吸光度の減少を追跡し、耐候性の加速試験を行った。その減少率を耐候性の指標とした。

#### (9) 残モノマー量

ガスクロマトグラフィー(GC-7AG、(株)島津製作所製)及び/又は液体クロマトグラフィー(655A-11、(株) 日立製作所製)により定量し残モノマー量を求め安全性の指標とした。

#### (10)粒子の再分散性

10gの精製水に1gの紫外線吸収性の樹脂粒子を分散させ、もとの水性樹脂エマルジョンの性状と比較し、再分散性を下記の基準で評価した。

大声标

〇:もとの水性樹脂エマルジョンと同じ状態に再分散する。

△:やや凝集がある。

×:凝集が激しい。

t	١	v	
ľ	ř	Я	
•	•	•	

		$ imes \hat{m{\psi}}_{i}^{(t)}$														
粒子の	再分散性	0	0	◁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×
残モノフー語	(%)	0.03	0.002	0.08	0.03	0.1	0.05	0.01	0.01	0.02	0.002	0.08	0.1	0.3	0.09	5.2
耐條性	(%)	20	18	10	7	16	18	8	10	7	6	2	7	56	22	22
吸収性	ω	17, 000	19, 000	25, 000	22, 000	16,000	16,000	26, 000	20,000	21,000	28,000	18,000	22,000	18, 000	10,000	6,000
紫外線吸収性	λ <sub>me.x</sub> (nm)	271	315	290	320	315	286	310	281	310	310	285	320	122	271	271
耐水性		0	◁	0	0	0	0	Ö	Ö	0	0	0	0	×	0	0
機械的安定	性 (%)	0.001以下	0.001以下	0.03	0.02	0.03	0.003	0.001以下	0.02	0.01	0.04	0.03	0.03	0.001以下	11.8	23.6
希釈安	定性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×
高温放置	安定性	0	0	0	0	◁	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×
執		均一透明	*	*	•	*				*	*	*		均一透明	乳白濁	"
粒径	(mm)	0.02以下	0.03	0.03	0.02	0.09	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.02	0.03	0.01以下	0.2	0.7
		1	23	က	4	ಬ	9	7	&	69	10	=	12	-	2	3
				ŧ	K		超			<u> </u>		_		뀼	数	室

### 請 求 の 範 囲

- 1. 分子吸光係数が10000以上の紫外線吸収能のある基を有する重合性単量体(a) 20~95重量%及び塩生成基を有する単量体(b) 5~80重量%を必須成分として 含有する単量体混合物を用いて、溶剤中で溶液重合を行い、続いて水を加えた 後、溶剤を留去し水系に転相することを特徴とする紫外線吸収能を有する自己 分散型水性ビニル樹脂の製造法。
- 2. 分子吸光係数が10000以上の紫外線吸収能のある基を有する重合性単量体(a) が一般式(I)で表される(メタ)アクリルアミド系単量体である請求項1記載の製造法。

$$CH_{2} = \begin{matrix} R_{1} \\ I \\ C \\ C \\ -N-Y \\ 0 \\ R_{2} \end{matrix}$$
 (1)

(式中、 $R_1$ は水素原子又はメチル基であり、 $R_2$ は水素原子又は炭素数  $1 \sim 4$  のアルキル基であり、Y は紫外線吸収能のある基を表す。)

3. 分子吸光係数が10000以上の紫外線吸収能のある基を有する重合性単量体(a) が一般式(II)で表される(メタ)アクリル酸エステル系単量体である請求項1記載の製造法。

$$CH_{2} = \begin{matrix} R_{1} \\ C \\ C \\ C - 0 - Y \\ 0 \end{matrix}$$
 (11)

(式中、R<sub>1</sub>は水素原子又はメチル基であり、Yは紫外線吸収能のある基を表す。)

4. 分子吸光係数が10000以上の紫外線吸収能のある基を有する重合性単量体(a) が一般式(III) で表される置換ビニルベンゼン系単量体である請求項1記載の製造法。

$$CH_2 = C$$

$$V$$
(III)

(式中、R1は水素原子又はメチル基であり、Yは紫外線吸収能のある基を表す。)

- 5. 請求項1に記載の製造法で得た自己分散型水性ビニル樹脂を脱水処理することを特徴とする紫外線吸収能を有する微小樹脂粒子の製造法。
- 6. 溶液重合の後、中和剤を加え塩生成基をイオン化する請求項1記載の製造法。
- 7. 分子吸光係数が10000以上の紫外線吸収能のある基を有する重合性単量体(a) 20~95重量%及び塩生成基を有する単量体(b) 5~80重量%を必須成分として 含有する単量体混合物を重合して得られる、粒径が 0.001~0.1 μm である紫外線吸収能を有する微小樹脂粒子。

Sales Services

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/JP92/00663

		International Application No PC	T/JP92/00663
		N OF SUBJECT MATTER (if several classification symbols apply, indicate all) <sup>6</sup>	
			t. Cl <sup>5</sup>
C081	F212/1	14, C08F220/06, C08F220/28, C08F220/36,	C08F220/58,
C081	<u> </u>	02, C08F220/60, C08F222/02, C08F6/14, C	08F8/44
II. FIELDS	S SEARCH	HED	
		Minimum Documentation Searched 7	
Classification	on System	Classification Symbols	
		C08F212/14, C08F220/06, C08F220/28, C	በጸፑ220/36
IPO	2	C08F220/58, C08F220/60, C08F222/02, C	001220/30, 08F6/14
		C08F8/44, C08L101/02	0010/14,
		Documentation Searched other than Minimum Documentation	
		to the Extent that such Documents are included in the Fields Searched •	
		•	
		• • •	
		<del></del>	
		CONSIDERED TO BE RELEVANT 9	
Category •		tion of Document, 11 with indication, where appropriate, of the relevant passages 12	Relevant to Claim No. 13
A		A, 53-16093 (L'Oreal),	1-5
	repr	ruary 14, 1978 (14. 02. 78),	
		im & FR, A, 2359857	
	α υΞ	5, A, 4166109 & DE, A1, 2734149	
A	.TD	A, 50-25740 (L'Oreal),	1 5
**		ch 18, 1975 (18. 03. 75),	1-5
	Clai	im (Family: none)	
	0	in (I what's Home)	
х	JP,	A, 2-91109 (Natoco Peint K.K.),	1-7
		ch 30, 1990 (30. 03. 90),	_ ,
		2 17, lower left column, pages 1 to 2	•
Y		A, 2-180909 (Ipposha Yushi	1-7
i		70 K.K.),	
		7 13, 1990 (13. 07. 90),	<b>!</b>
	Clai	im (Family: none)	
,	~~	7 60 10000 (111) 17 77 7	
A		A, 62-109808 (Mitsubishi	1-7
		cochemical Co., Ltd.)	
	Page	21, 1987 (21. 05. 87), 2 1 & EP, A, 209299 & US, A, 4778866	
	Lage	- 1 α Δ1   A1 209299 α US, A, 4//0000	
* Special	Catagories :	of cited documents: 10 "T" later document published after	the international fillian data as
"A" docu	ument defin	ning the general state of the art which is not priority date and not in conflict	with the application but cited to
cons	sidered to b	pe of particular relevance understand the principle of the	• •
filing	g date	nt but published on or after the international be considered novel or canno inventive step	t be considered to involve ar
"L" docu	ument whic	th may throw doubts on priority claim(s) or to establish the publication date of another "Y" document of particular relevance	e; the claimed invention cannot
citat	ion or other	r special reason (as specified) be considered to involve an involve is combined with one or more	entive step when the document other such documents, such
	ument refer r means	ring to an oral disclosure, use, exhibition of combination being obvious to a	person skilled in the art
"P" docu	ment publi	ished prior to the international filing date but	patent family
	IFICATIO		
		empletion of the International Search Date of Mailing of this International	Search Report
_	_		,
Augu	ist J,	1992 (05. 08. 92)   September 1, 1992	(01. 09. 92)
Internation	al Searchin	ng Authority Signature of Authorized Officer	<del></del>
		Patent Office	
- ~ ~ ~			

													圖	<b>を</b> 田	联准	号P	CI	/.	P	9	2	/	0	0	6 (	6 3	3
I. 癸	明の属する	分野の	の分	類						:			_	_				_				_			-		
国際特許	分類(IPC	) <sub>T</sub>	n f	r	ß	-	7 /	. 2	E o		, ,	/1	4	_	1 ^	0 1	3 0	•	^		^	<u> </u>					
1		Ĉ	0 8	₹	2 2	ດີ	/2	የ ጽ	r z	n	6 / R %	1 29	2	) n	/ 3	e 0 1	: 4 C	L	Q Q	<u>/</u>	2	О, 9	Λ	/	<b>5</b> 1	D.	
		Č	0 8	L	10	1	/o	2	Č	0	RI	12	2	0 / 0 /	/ 6	O,	ר	n	R	r	9	2	2	//	0 '	o, 9	
		Ç	0 8	F	6/	ī	4.	c	08	F	B /	4	4	•	U	Ο,		•	0	£	~	L	. مه		0 4	۵,	
11. 国	原調査を行・	ったケ	野								-/-		-	_						-						_	
				調	査	を	:	ñ	2	た		段	小	-	製	資	*	Ī									
分類	体 系							-	分	類	i -	25	号									_					
		C	ი გ	} }	2 1	2	/1	4	C	0 1	RT	2	2 1	0 /	<u> </u>	6	~	0	Q	P	2	2	Λ	/	2 1	2	
-	_	Č	0 8	F	22	õ,	/3	6.	Č	0.1	RI	2	2	מי מי	/5	e, R	C	n	Q Q	P	2	2	n		2 ( 6 (	ት ነ	
IP	<u>ر</u>	C	0 8	F	2 2	2	/ ō	2	Č	0.8	BE	6	7	1 4	Į.	$\ddot{\mathbf{C}}$	8 (	F	8	_	ā	4			•	••	
		C	0 8	L	10	1,	/ o	2	Ī						•	•		_	Ŭ			-	•				
				1	设小	限貨	料	以夕	103	資料	で	月1	E &	ñ.	った	60	)		_								
										٠.															_		
									;	<u>{</u>										•							
,																				•							
Ⅲ. 関i	重する技術に	く関す	る;	文献																	-					_	
引用文献の カテゴリー ※	引用了	く献え	3	及び	一部(	の簡	听力	開力	计	ر او ح	+ 64	,	- nt	V5.16	<b>-</b>	Z 557 F	EΛ	连:	<del>-</del> -		ī		+	- 42		~ #	. m
X7 2 7 ~							,,,,			>	-		_	~~	: , .	) ( <u>n</u> ) /		200,7	'\ 		_	ē Pi	жи —	リ <b>東</b>	囲	ク値	· 도 ——
A	JP, A		3	_ 1	1 6	n a	2		- 1)	7		١											,	١	· 5		
	14. 2																						1	. –	·		
	特許請																										
														~ .													
	&US.	Δ,	4	1	00	1 (	, 9	Œ	א ע	j,	Α.	l,	Z	7 ;	3 4	1	4 5	,									
• 🛦	T TO A		. ^	_ (		7 A	^	,	_ 11	٠		,											_		_		
A	JP. A													•									1	_	• 5		
	18. 3																										
	特許請:	<b>米</b> 火	7 171	124	( )	ァ	3	y	— 7 <u>.</u>		;;),																
X	T D A			^ .			,		•		٠.,			.b	_										_		
A	JP. A													休:	Α.	会社	: )	,					1	l –	· 7		
	30.3								) 3.	9	0	),															
	第1-	2 與	Æ	. 1	<b>,</b>	7	17																				
Y	TD A	c				^ ^		,	_	4.		<b>#</b>	<del>-</del> -	W- 1	<b></b>	<b>.</b> .	٠.,	,					_		_		
1	JP, A													ŧ.	朱玉	5 会	£İ	)	•				1	ا	· 7		
	13. 7											),												•			
	停許請:	<b>K</b> 0)	桶	进	( )	7	į	y	<u>رر</u> –	し	;)																
w 21 m ±	*>= :				_					<del></del>											_						
	献のカテゴ 関連のもなっ		. د در	,	én ar '	+	1. 200	<b>.</b> –	٠.	∴.Г	T	国	察出	頭目	又r	優先	日々	後	てイ	法	t 5	<b>した</b>	文	はて	あっ	って	出
「E」先行	関連のある文 文献ではある	が、「	はな 国彦	、一 出願	放时的	文例と	(事)	ፈጥ ኒክታ	丁もの トレハ	,						ので		: <b>〈</b> .	. 3	è明	のほ	<b>須理</b>	又1	は理	論の	D理	解
「L」優先	権主張に疑義	を提	記す	る文i	tt又r	t他の	文制	せのき	行目	F	χı					で 文献		·	7	꺂	<u>1</u> ¢ ₹	7 ±>	· ^ ·	L	<b>空</b> 柱中	Bσ	虹
若し	くは他の特別	な理	曲を	確立	するか	300	318	肘	5文献			規	性又	ュン t進	歩性	がな	いと	, 考	Ż.	コ	ベノ ろも	いい	) )	<b>→</b> C	ナビリ	ない	#7i
	由を付す)	Ht CD	_	. سم						, L	ΥJ	特	に関う	連の	ある	域文	でき	, ,	τ,	当	抜く	と献	2	他の	11	北上	Ø.
「P」国家	による関示、 出願日前で、	使用 かつ	、	小寺!	と言が	ひまた	文的	ズ トスコ	4 <b>6</b> 56 ~			文	はとの	D.	当業	者に	<u>د ع</u>	71	自り	で	ある	5組	合	せに	Į,	て	進
	という 後に公表され			,	- 315 /-	- ca ₩	:	. V I	1 84 V)		& I	少1	せかり ーパ・	よい テン	とろ	えらァミ	れるリー	· あく	<b>り</b> マギ	ŀ							
N. IZ	証																_										
										. [	-											_					<u>.                                    </u>
国際調査を	た」した日									] [3	感	胃查	報告	の発	送	3		_		_			_	_			
	05.	Ú	8.	9	2													0	1	. C	) (	<b>)</b> . !	9	2			-
国際調査機	¥		_							#	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	— ກ≭	る駐	<b>B</b>							Γ	_	Т	_		_	
												_									4	J	_  '	7 ,	2	4	2
8	本国特許	厅	(I	SA/	JP)					4	寺計	F方	審	査	官		<i></i>		_	_	_				<u> </u>		_
											•						谷		Ĺ	1		浩	ī	2	ij	•	ٱ

第2~	<b>ページから続く情報</b>										
	(亜傷の統さ)										
<b> </b>	JP, A, 62-109808(三菱油化株式会社),	1-7									
-	21. 5月. 1987(21. 05. 87),	_									
	第1頁&EP, A, 209299&US, A, 4778866										
ļ											
	· ·										
İ	a -	i									
₹ □	一部の請求の範囲について国際調査を行わないときの意見										
次の部	f求の範囲については特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第8条第3項の規	定によりこの国際									
調査報告	を作成しない。その理由は、次のとおりである。										
1.	請求の範囲は、国際調査をすることを要しない事項を内容とするもので	ある。									
	· · · · ·										
_	, <b>b</b> -										
2	2. 請求の範囲 は、有効な国際調査をすることができる程度にまで所定の要件を満たしていな										
	い国際出願の部分に係るものである。										
3. 🗌	請求の範囲は、従属請求の範囲でありかつ PCT 規則 6.4(a)第 2 文の規定	に従って起草され									
	ていたい。										
***	Zello M. Monthe than I do at the										
VI.	発明の単一性の要件を満たしていないときの意見										
次に遊	べるようにこの国際出願には二以上の発明が含まれている。										
	ig≨a →										
	- <del></del> -										
	· ,										
1. 🗆	追加して納付すべき手数料が指定した期間内に納付されたので、この国際調査報告は、	、国際出願のすべ									
	ての調査可能な請求の範囲について作成した。										
2.	追加して納付すべき手数料が指定した期間内に一部分しか約付されなかったので、この	国際調査報告は、									
手数料の納付があった発明に係る次の請求の範囲について作成した。											
	請求の範囲										
3. 🗀	3 追加して納付すべき手数料が指定した期間内に納付されなかったので、この国際調査報告は、請求の範										
	囲に最初に記載された発明に係る次の請求の範囲について作成した。										
	請求の範囲										
4. :	4. <u>□</u> 追加して納付すべき手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加して納付すべき手数料の納付を命じなかった。										
追加手	数料異議の申立てに関する注意										
	追加して納付すべき手数料の納付と同時に、追加手数料異議の申立てがされた。										
П	追加して納付すべき手数料の納付に際し、追加手数料異譲の申立てがされなかった。										